

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成16年9月9日(2004.9.9)

【公開番号】特開2003-44146(P2003-44146A)

【公開日】平成15年2月14日(2003.2.14)

【出願番号】特願2001-231753(P2001-231753)

【国際特許分類第7版】

G 0 5 D 21/00

F 1 7 C 5/06

【F I】

G 0 5 D 21/00 A

F 1 7 C 5/06

【手続補正書】

【提出日】平成15年8月25日(2003.8.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0038】

濃度が高くなると希釈ガスを多くなるよう充填し、濃度が下がると特定ガスを多くなるよう充填するように制御が行なわれる。そして、濃度と圧力が正しく充填できれば終了となるが、圧力が目標設定値よりも高くなった場合、該ガス分離部105を起動して被ガス充填容器のガスを循環させ、ガスを特定ガスと希釈ガスに分離し、被ガス回収容器内の濃度が高いのであれば分離した特定ガスは回収部107に回収し、希釈ガスを被ガス回収容器に戻し、濃度を下げる。

同じく濃度が低い場合は分離した希釈ガスを回収部106に回収し、特定ガスを戻して濃度を上げる。濃度に問題が無い場合は、余剰ガスとして両ガスを回収部に回収し、外気に漏出することはない。